2 018 年海 外教师 主导本 科全英 文课程报告人： 尹友教授，日本群马大学

报告地点： 教四 309教室

报告内容： 半导体工艺制备技术系列讲座

17t h, Sep. , 2018

1. Advanced nanofabrication process-

lig hogr aphy 8:30-11:30am Photolighography Electron beam lighography Other advanced lithography technologies 21th, Sep., 2018

2. Advanced nanofabrication process- etching

8: 30-11: 30am W et chemical et ching Dry etching Advanced etching technologies 22th, Sep., 2018

3. Advanced m emor ies 6pm-9pm High-performance phase-change memory High-performance resistive random access memory Other advanced memory technologies 23th, Sep., 2018

4. Advanced solar celMl Ml Ml Ml Mlrla Hig

d

a灶鼣∟

d

3o

201 Sep灅䠍.

t

H

2

vt

igAdvanc

b䐠㐐㤐퀄뀀

p灅䠍

acsd

h

oleha災r gie

ceoala災y Ml

a

te

b퀄 ro

ce Ml Ml Ml∇靈Ѱ r a Higacd

Ӏs

alehonacd

H

hacd Ӏↄ祰퀅 s

O thb鈵捡აՐ advancv⍖㘑㤐퀄뀀 acd

ie

3t bє胐

Sebє胐Đ

,

201

a�入

Advancc✅⁹盲㈡퀄瀀

oc✅⁹紀

proci3✅⁹焹აԐ

ce